

## CIGS薄膜太陽電池的發展 與未來

技術主編: 翁榮洲

現職:工研院材化所(MCL/ITRI)功能設計與複材研究組 組長

專長:電化學、防蝕、材料保固

學歷:國立清華大學材料科學與工程研究所 博士

2008年矽晶太陽電池市占率 87.5% 為市場主流,雖然薄膜太陽電池占整體太陽能發電的比例仍偏低,但市占率較 2007 微幅成長 2.1%,達 12.5%,預計 2015 可達 30%。目前薄膜太陽電池以 a-Si、 CdTe、 CIGS 三種為主, 2007年 a-Si 占有率 50%, 2008年因 First Solar 擴廠且模組效率大於 10%,每瓦的價格降至 1 美元以下,因此 2008年 CdTe 的市場占有率首度超過 a-Si,達 60%。根據紐約時報報導,歐盟正考慮修改有害物質法規,將禁用範圍擴大到所有電子產品,薄膜太陽電池的原料-鎘,亦在禁用之列。歐盟-旦修法通過,將使 CdTe 薄膜太陽電池的發展及其業界龍頭 First Solar 遭受衝擊。反觀 CIGS 薄膜太陽電池因具備實驗室小試片有效率最高(20%)的優勢,加上多樣創新技術投入,假以時日透過學習曲線,有可能會後來居上,成為次世代太陽電池中最高速成長的產品。

CIGS 雖具有高度潛力,但截至目前商業化量產的產能不大目均屬真空製程,其中包括德國的 Würth Solar(共蒸鍍, 30 MW/y)及 Q-cell/Solibro(共蒸鍍, 30 MW/y)公司:美國的 Global Solar(共蒸鍍, 不銹鋼箔, 45 MW/y)及 Solyndra(共蒸鍍, 150 MW/y)公司:日本的 Showa Shell(濺鍍+  $H_2Se+H_2S$ 高溫硒化, 30 MW/y)及 Honda(濺鍍+  $H_2Se$ 高溫硒化, 27.5 MW/y)公司等。 CIGS 產業化面臨的最大問題在於大面積的均匀性,以共蒸鍍製程而言,受限於線性蒸鍍源的問題,大面積均匀性仍有待改善。濺鍍後之硒化製程目前較成熟技術為以  $H_2Se$  氣體的高溫硒化,但缺點為製程時間長且使用毒性氣體。近年來德國廠商雖然開發以 RTP (Rapid Temperature Program)為主的硒化技術,希望能解決此問題,目前小面積雖已經過驗證,但大面積 RTP 硒化技術仍在測試中。

另外以非真空加 Roll to Roll 的可撓式製程是未來 CIGS 技術的重要趨勢。美國 Nanosolar 在 2009 年 9 月的白皮書發表以 Roll to Roll 塗佈 CIGS 漿料製程做的小面積電池元件效率可達 16.34% : SoloPower 也在今年宣布採 Roll to Roll 的電鍍製程所做的 GIGS 模組( $10720~{\rm cm^2}$ )效率可達 10% 。 不過是否能順利量產,都仍有待觀察。

展望未來,CIGS 的產業仍會蓬勃發展。日本昭和殼牌於 2009 年 7 月宣布將投資近一千億日圓興建年產 1 GW 的 CIGS 太陽電池廠,預定 2011 年完工。而國外已投入建置量產設備但產品尚未大量問世的公司包括:德國 Johanna Solar(濺鍍 +  $H_2$ Se +  $H_2$ S 高溫硒化)、 Avanic(濺鍍 + RTP 硒化 +  $H_2$ S 硫化)、 Odersun(電鍍 + 硫化,銅箔):美國 Miasole(濺鍍 + 硒化,不銹鋼箔)、 Daystar(濺鍍 + 硒化,不銹鋼箔)、 SoloPower(電鍍 + 硒化,不銹鋼箔)、 Ascent Solar(共蒸鍍,PI)、 Heliovolt (Field Assisted Simultaneous Synthesis and Transfer; FASST)、 Nanosolar(塗佈 + RTP 硒化,鋁合金箔)。在台灣也有新能光電、太陽海及正峰機械等公司積極投入,未來 CIGS 的產業發展值得拭目以待。

CIGS 量產技術尚未完全成熟,產業還在萌芽期,仍有待更多的研發工作投入。工研院在經濟部技術處的支持下,自 2008 年開始進行 CIGS 太陽電池技術的開發,相關的設備也已陸續建置完成,期待與國内業者共同努力,建構國内 CIGS 薄膜太陽電池產業。 ፟